

7th International Workshop on Advanced Plasma Processing Diagnostics & Thin Film Technology for Electronic Materials 派遣報告

名城大学理工学研究科電気電子工学専攻 大平 真

去る7月4日、5日に韓国の成均館大学で行なわれた、The 7th Korea-Japan Workshop on plasma Technology, 「Thin Film and Plasma Technology for Next Generation Energy Advanced Plasma Diagnostics for Plasma-Nano Processing」に参加しました。その中の Korea-Japan international young researchers session というカテゴリーにて、私は「Shape change of carbon nanowalls grown using inductively coupled plasma-enhanced chemical vapor deposition」というタイトルで、プラズマ CVD 法を用いたカーボンナノウォールと呼ばれるカーボンナノ構造体の作製と、作製条件による形状の変化に関する研究成果をポスターで発表しました。

young researchers session は、韓国の学生5名、日本の学生5名、計10名の oral session と、日本と韓国の学生計35名の poster session から構成されていました。韓国の学生、日本の学生共に、発表はとても堂々としていて、日頃の研究成果が遺憾なく発揮されていました。発表を見て、自分もさらに真剣に研究に取り組んでいきたいと、非常に刺激になりました。また、質疑応答の時間では、学生が率先して質問をする姿が見られ、さらに発表者は質問に対してしっかりと回答しており、その点もすばらしかったと思います。

韓国や日本の先生方の講演では、プラズマ応用やプラズマ診断などのプラズマ工学に関する最先端の技術の話聞くことができました。半導体作製に関する薄膜作製、エッチング、絶縁層の low-k フィルムの作製などに関する技術や、プラズマ診断技術、ソーラーセルや燃料電池応用への薄膜作製技術など、プラズマ応用の最先端の技術の話題を興味深く聞かせていただきま

した。特に自分の研究に関係のあるプラズマを利用した薄膜作製技術の話では、自分の研究に何か活かせることはないかという思いで聞かせていただきました。

講演後には成均館大学の研究室の見学をさせていただきました。成均館大学は、とても広いキャンパスと一面ガラス張りのきれいな建物が印象的でした。いくつもの研究室があり装置も充実していました。室内はとてもきれいで工具類も整頓されており、研究がしやすい環境になっていたことに大変感心しました。たくさん見習わなければいけないところがあったと思います。

夕食では交流会も兼ねたバーベキューパーティを開いていただきました。そこで韓国の学生の方々と交流の場を持つことができました。お互いの研究のことやそれぞれの国のことなどいろいろな話をしました。言葉の壁を感じたことも確かにありましたが、それ以上に、何とかして相手に伝えようとする気持ちが重要なんだと感じました。

今回の韓国での経験は、私にとって非常に刺激的で貴重なものとなりました。また学業だけでなく日常生活においても学ぶことがたくさんありました。最後に、このようなすばらしい機会を与えていただいたことに感謝いたします。